DE LA RECHERCHE À L'INDUSTRIE



Etudes expérimentale et numérique d'un limiteur de puissance en technologie microruban suspendue utilisant un plasma de décharge

L. Fuster^{1,3}, A. Simon^{2,3}, R. Pascaud², T. Callegari³, P. Hoffmann¹, G. Hagelaar³, L. Liard³ et O. Pascal³

¹ Commissariat à l'Energie Atomique, Gramat, France ² Institut Supérieur de l'Aéronautique et de l'Espace (ISAE), Toulouse, France ³ LAboratoire PLAsma et Conversion d'Energie LAPLACE, Toulouse, France

CONTEXTE

Historiquement, les premiers dispositifs à utiliser des plasmas pour la limitation de puissance étaient les « Transmit/Receive tubes » [1] dans les guides d'ondes. De nos jours, les circuits microondes on été miniaturisés à l'aide de lignes microruban. Des limiteurs classiques tels que les diodes PIN, les diodes Schottky [2] ou les MEMs [3] sont utilisés afin d'assurer la protection des circuits contre les agressions électromagnétiques. Cependant, avec la montée en puissance des sources électromagnétiques, les limites de tenue en puissance de ces limiteurs commencent à être atteintes, et d'autres voies doivent être explorées. Ici, nous présentons un nouveau prototype de limiteur en technologie microruban suspendue, intégrant un plasma d'Argon. Le dispositif a été caractérisé expérimentalement en terme de limitation de puissance. De plus, la structure quasi-TEM du champ électrique dans le limiteur permet d'effectuer des simulations en 2D : l'interaction non-linéaire entre le champ microonde et le plasma a été étudiée à l'aide du code de calcul PlasmaSimWave, développé au LAPLACE, afin de mieux comprendre les phénomènes en jeu dans le dispositif. En outre, nous présentons une comparaison directe des résultats expérimentaux et numériques.



-SIMULATION (CODE PLASMASIMWAVE [4])

Géométrie simulée (2D)

Modèle microonde



DYNAMIQUE DU PLASMA

Comparaison luminosité (U.A.) / Taux de création des métastables (m⁻³.s⁻¹) à P_{inc} = 39 dBm





121 µs

253 µs

70

✓ 6 cm



Modèle plasma

► électrons : équations de continuité, de dérive-diffusion et d'énergie

 $\frac{3e}{2}\frac{\partial(n_eT_e)}{\partial t} + \boldsymbol{\nabla} \cdot \left(\frac{5e}{2}n_e\boldsymbol{v}_eT_e + \boldsymbol{Q}_e\right) = \underbrace{\alpha n_eP}_{\text{couplage microonde}} - en_e\boldsymbol{v}_e \cdot \boldsymbol{E} - \Pi_{\text{couplage microonde}} \rightarrow \text{plasma}$

▶ ions : équations de continuité et de quantité de mouvement

CHIMIE DU PLASMA

Réactions chimiques prises en compte

#	Réaction	Taux de réaction	Commentaire
1	$e + Ar \rightarrow 2e + Ar^+$		Ionisation directe
2	$e + Ar \rightarrow e + Ar^*$		Excitation par impact
3	$e + Ar \rightarrow 2e + Ar^+$		Ionisation par étape
4	$e + Ar^* \rightarrow e + Ar$		Désexcitation
5	$e + Ar^* \rightarrow e + Ar$		Quenching
6	$Ar^* + Ar^* \rightarrow e + Ar_2^+$	0,7 x 6,4.10 ⁻¹⁶ m ⁻³ .s ⁻¹	Ionisation Ar*-Ar*
7	$Ar^* + Ar^* \rightarrow e + Ar^+ + Ar_2^+$	0,3 x 6,4.10 ⁻¹⁶ m ⁻³ .s ⁻¹	Ionisation Ar*-Ar*
8	$Ar^+ + 2Ar \rightarrow Ar_2^+ + Ar^-$	2.10 ⁻⁴³ m ³ .s ⁻¹	Formation des ions mol.
9	$e + Ar_{2}^{+} \rightarrow Ar + Ar^{*}$	7,35.10 ⁻¹⁴ x T ^{-2/3} m ⁻³ .s ⁻¹	Recombinaison dissociative

Quatre modèles chimiques testés

Modèle Réactions Distribution élec.





► Passage de la puissance EM majoritairement par le haut du dispositif → en accord avec les résultats numériques (cf. dissymétrie du profil pour le taux de création).

Densité électronique (m⁻³) à P_{inc} = 39 dBm





Formation d'une structure de densité quasi-stable qui se propage.









- Fonction de distribution des électrons non maxwellienne.
- Effet prépondérant des métastables (93,2 % d'électrons créés par la réaction 4 à 39 dBm).



formation de la structure quasi-stable.

Laplace

structure quasi-stable $t_2 = 36,9 \,\mu s$

- PERSPECTIVES

- Dérivation de modèles analytiques pour relier la largeur du front, la vitesse de propagation du plasma, l'absorption de puissance dans le front, etc. aux paramètres fondamentaux du plasma.
- Étude de l'influence du gaz et de la chimie sur le temps de claquage et le seuil de limitation en puissance.
- Étude de l'effet de la fréquence de l'onde électromagnétique sur le rapport P_{out} / P_{in}.
- Étude numérique de l'effet de la réduction du volume du plasma sur la limitation de puissance.

RÉFÉRENCES-

[1] L. D. Smullin and C. G. Montgomery, *Microwave Duplexers*, McGraw-Hill Book Company, Inc., 1948.
[2] S. S. Yang, T. Y. Kim, D. K. Kong, S. S. Kim, and K. W. Yeom, "A novel analysis of a ku -band planar p-i-n diode limiter," *IEEE Trans. Microw. Theory Tech., vol. 57, no. 6, pp. 1447–1460,* June 2009.
[3] SD. Shojaei-Asanjan, S. Attar, and R. R. Mansour, "Tunable rf memsbased frequency dependent power limiter" *in IEEE MTT-S Int. Microw.* Symp. Dig., May 2016.
[4] G. J. M. Hagelaar *et al.* "Modelling of a dipolar microwave plasma sustained by electron cyclotron resonnance", *Journal of Physics D*, 2009.

www.cea.fr









Institut Supérieur de l'Aéronautique et de l'Espace